

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成28年4月14日(2016.4.14)

【公開番号】特開2014-191129(P2014-191129A)

【公開日】平成26年10月6日(2014.10.6)

【年通号数】公開・登録公報2014-055

【出願番号】特願2013-65415(P2013-65415)

【国際特許分類】

G 02 F 1/1339 (2006.01)

G 02 F 1/13 (2006.01)

G 02 F 1/1345 (2006.01)

【F I】

G 02 F 1/1339 5 0 0

G 02 F 1/13 1 0 1

G 02 F 1/1345

【手続補正書】

【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

第1基板と、

前記第1基板と対向する位置に配置された第2基板と、

前記第1，第2基板間の距離を一定範囲に保持するスペーサ材と、

前記スペーサ材と同じ材料により形成され、かつ、前記第1基板の額縁領域のコーナー部において当該第1基板のマザーベース板からの切断ラインの交差部分の周辺領域に形成された切断マークと、

前記第1，第2基板の表示領域を囲むシール材と、

前記スペーサ材と同じ材料により形成され、前記切断ラインに沿って、かつ、前記第1基板において前記切断マークに対して予め定められた間隔をあけて形成された切断補助パターンとを備え、

前記シール材は、前記第1，第2基板の額縁領域のコーナー部において液晶の注入口を形成する2つの突出部を有するように分割され、当該2つの突出部の先端がそれぞれ前記切断マークと前記切断補助パターンに当接するように形成された、液晶表示装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

請求項3から請求項5のいずれか1つに記載の液晶表示装置の製造方法であって、

前記切断マークまたは前記切断補助パターンは、前記スペーサ材と同時に形成された、液晶表示装置の製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

本発明に係る液晶表示装置は、第1基板と、前記第1基板と対向する位置に配置された第2基板と、前記第1，第2基板の額縁領域のコーナー部に形成されたトランスファ材と、前記第1，第2基板間の距離を一定範囲に保持するスペーサ材と、前記スペーサ材と同じ材料により形成され、かつ、前記第1基板において当該第1基板のマザー基板からの切断ラインと前記トランスファ材との間に形成された切断マークとを備えたものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

また、本発明に係る液晶表示装置の製造方法では、前記切断マークまたは前記切断補助パターンは、前記スペーサ材と一緒に形成されたものである。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0047】

C F 基板9は、透明基板である厚み0.1mm程度の極薄ガラスにより形成されたガラス基板51を備えている。さらに、C F 基板9は、ガラス基板51の一方の面に液晶を配向させる配向膜52と、配向膜52の上部に配置されたTFT基板8上の画素電極43との間に電界を生じ液晶を駆動する共通電極53と、共通電極53の上部に設けられるそれぞれのカラーフィルタ54間を遮光するため、或いは表示領域30に対応する領域外側に配置される額縁領域31を遮光するために設けられる遮光層であるブラックマトリクス(Black Matrix: BM)55などを備えている。また、ガラス基板51の他方の面には、2画面ディスプレイとして、視野方向を2方向に分離する遮光層である視差バリア56が配置されており、視差バリア56においては、画素内に配置されるBM55の開口部とずれた位置にスリット状の開口部が形成され、視野方向を分離し制限している。さらに、視差バリア56よりも外側(上側)には、偏光板65が配置されている。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0058】

マザーTFT基板とマザーセンサ基板19の製造方法については一般的な方法を用いてもよいため、簡単に説明する。先ず、マザーTFT基板については、公知の製造方法を利用して、ガラス基板41の一方の面上に、成膜、フォトリソグラフィー法によるパターニング、エッチング等のパターン形成工程を繰り返し用いてTFT44および画素電極43、ゲート配線46およびソース配線47などの配線層、さらに信号端子48、トランスファ電極を形成することにより製造される。